

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】令和 3 年 4 月 8 日 (2021.4.8)

【公開番号】特開 2019-203155 (P2019-203155A)

【公開日】令和 1 年 11 月 28 日 (2019.11.28)

【年通号数】公開・登録公報 2019-048

【出願番号】特願 2018-97404 (P2018-97404)

【国際特許分類】

C 2 3 C 16/505 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

H 0 1 L 21/31 (2006.01)

H 0 1 L 21/316 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 16/505

H 0 1 L 21/302 1 0 1 B

H 0 1 L 21/31 C

H 0 1 L 21/316 X

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 2 月 16 日 (2021.2.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

前記シャワープレートの直下に設けられ、前記シャワープレートを通過する前記第 1 の容量結合プラズマ中のイオンを除去するイオントラップをさらに備える、請求項 5 に記載の成膜装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 0】

そこで、図 10 に示すように、成膜が進行した (a) の状態 (図 9 の (b) と同じ状態) で、第 2 の容量結合プラズマ P 2 の基板 W にイオンのアシストによるエッチング作用を及ぼして、膜の厚さを均一にすることによりストレスを調整する ((b) 参照)。これにより、凹部 2 0 2 への膜 2 0 3 の埋め込みが完了した時点で膜ストレスが低減される ((c) 参照)。